

Печь быстрого термического отжига RTP 150 / RTP 150-EP



Производитель:

Unitemp

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Серия	RTP
-------	-----

Описание

Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерийного производства.

Установки RTP 150 / RTP 150-EP позволяют работать с образцами до 150 мм в диаметре. Рабочая нагреваемая область: 156×156 мм. Загрузка подложек в

рабочую камеру производится вручную. Максимальная температура процесса — до +1000 °С (до +1200 °С в версии RTP 150-EP). Максимальная скорость нагрева — до 75 К/с (до 150 К/с в версии RTP 150-EP). Возможно проведение процессов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при помощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Технические характеристики установки

Максимальный размер подложки	Диаметр 150 мм (6") , рабочая область 156×156 мм
Материал камеры	Кварцевое стекло (водоохлаждаемая камера)
Высота камеры	40 мм
Система загрузки подложек	Поддон из кварцевого стекла;
	Оptionальный держатель из пирографита или графита, покрытого SiC
Уровень вакуума	До 10 ⁻³ мбар
	До уровня 10 ⁻⁶ мбар (модель RTP 150-HV)
Максимальная температура процесса	До +1000 °С / До + 1200 °С в версии RTP 150-EP
Тип нагревателя	ИК-лампы (общая мощность 21 кВт / 42 кВт в версии RTP 150-EP)
Зоны нагрева	Верхняя и нижняя (программируемые)
Скорость нагрева	До 75 К/с / До 150 К/с в версии RTP 150-EP
Скорость охлаждения	От +1000 до +400 °С: 200 К/мин От +400 до +100 °С: 30 К/мин подложка охлаждается азотом
Температурный контроллер	Встроенный
Используемые газы	Азот, кислород, форминг-газ В базовой комплектации один РРГ 5 slm
Электропитание	3×32 А, 380 В, 3 фазы
Размер установки (Ш×Д×В)	505×504×420 мм (настольное размещение)

Вес печи	75 кг
-----------------	-------

Опции

- Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.)
- Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, покрытого SiC
- Дополнительная термопара
- Различные вакуумные насосы
- Чиллер
- Дополнительная рабочая камера